Mini-PFE 100 / 200

Präzise, physikalisch saubere Zelle



Ausrüstung zur kontinuierlichen automatischen Bearbeitung der Ober- und Unterseite streifenförmiger Werkstücke

Kleine Zellen mit breiter Kanone werden in der Elektroindustrie wie Leiterplatten oder Halbleiter eingesetzt. Durch die gleichmäßige Bearbeitung auf beiden Seiten kann es für Stab- und Blattform verwendet werden. Anwendbar für Keramik- und Cu-Platten.

Besonderheit

- Funktionen sind integriert, die Nassstrahl-Verarbeitungsqualität bleibt jedoch erhalten. Neu entwickelte Zelle als kleiner und kostensparender Zweck.
- Kompakte Strahl- und Wasserspülteile erleichtern die Wartung der Aktuatoren. Öffnen Sie einfach eine Förderbandabdeckung. Auch die breite Pistole und die Pumpe als Hauptteile weisen noch immer die ursprüngliche hohe Haltbarkeit auf.
- Angebot von 2 Typen (Mini-PFE 100/200) entsprechend der Werkstückgröße.

Spez

mini PFE 100

Größe $1200 \text{ (B)} \times 1250 \text{ (T)} \times 1600 \text{ (H)} \text{ mm}$

Arbeitsgröße Breite: 20–100 mm Länge: 100–250 mm

Dicke: 0,1-1,5 mm

Transportgeschwindigkeit des Förderers Förderers Förderers Förderers

Pistole Wide Pistole 110 mm Je eine für oben und unten **StromversorPistoleg** AC200V, 50/60Hz, 3 Phasen

Energieverbrauch Etwa 2,6 kW (Gesamtnennscheinleistung aller Geräte)

LuftversorPistolegsdruck 0,5 MPa-0,7 MPa

Luftverbrauch 4,1m³/min (NTP bei 0,25 MPa des voreingestellten

Strahlluftdrucks)

Mini-PFE 200

Größe $1200 \text{ (B)} \times 1650 \text{ (T)} \times 1650 \text{ (H)} \text{ mm}$

Arbeitsgröße

Breite: 20–200 mm

Länge: 100–250 mm

Dicke: 0,1–1,5 mm

Transportgeschwindigkeit des 0.1.2.0 m/mil

Förderers 0,1–3,0 m/min

Gun Wide Gun 220 mm Je eine für oben und unten

Stromversorgung AC200V, 50/60Hz, 3 Phasen

Energieverbrauch Etwa 4,3 kW (Gesamtnennscheinleistung aller Geräte)

Luftversorgungsdruck Luftverbrauch

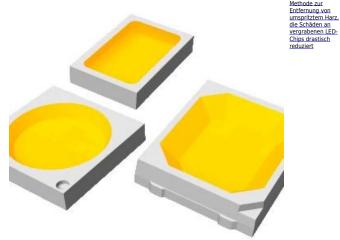
0,5 MPa-0,7 MPa 7,7 m³/min (NTP bei 0,25 MPa des voreingestellten Strahlluftdrucks)

Verwandte Seiten

Verwandte Anwendungen



Vorbehandlung für die Galvanisierung, um Grate zu entfernen, ohne die Halbleiter zu beschädigen (Entgratung)



Bearbeitungsmethode zur Entfernung dünner Grate (Flash-Grat) ohne Beschädigung des LED-Gehäuses

